計測自動制御学会東北支部第 181 回研究集会(1999.5.21) 資料番号 181-7

感温金属酸化物薄膜を用いた酵素センサシステム

Enzyme Sensor System Utilizing Temperature-Sensitive Metal Oxide Thin Film

○渋谷龍史,谷地善光,柿崎和毅,久保田恒夫,高橋政雄,佐々木圭一,長田 洋, 千葉茂樹,関 享士郎

OTatsushi SHIBUYA, Yoshimitsu YACHI, Kazutake KAKIZAKI, Tsuneo KUBOTA, Masao TAKAHASHI, Keiichi SASAKI, Hiroshi OSADA, Shigeki CHIBA and Kyoshiro SEKI

岩手大学

Iwate University

キーワード:金属酸化物 (metal oxide), 真空蒸着法 (vacuum deposition method), 酵素センサ (enzyme sensor), サーミスタ (thermistor), 測温素子 (temperature measuring element)

連絡先:〒020-8551 岩手県盛岡市上田 4-3-5 岩手大学工学部電気電子工学科 電子システム工学講座

関 享士郎, Tel: 019(621)6380, Fax: 019(621)6380, E-mail: seki@iwate-u.ac.jp

1. 緒言

現在,サーミスタ¹⁾やバリスタ²⁾をはじ め多くの金属酸化物デバイスが開発され, 計測・制御,電子回路などの分野で活用さ れている.それらの多くはバルクまたは厚 膜に成形して使用されているが,その薄膜 は材料である酸化物の融点が高いため,作 製が困難であり,また均一な組成のものが 得られにくい.このような問題を解決する ため,筆者等は融点の低い金属を酸化する と酸化物になるという特性に着目し,鉄, ニッケル,マンガン等を真空蒸着法を用い て順次蒸着して多層膜を形成し,その後, 高温でアニーリング処理を施して金属酸化 物に転換する方法を開発した.本方法で は,アニーリング処理後の金属成分比に大 きな変化がみられず良好な再現性が得られ る.筆者らは,この方式を用いて感温金属 酸化物薄膜(Temperature-Sensitive Metal Oxide Thin-Film: TMT)を試作した^{3),4)}. TMT の膜厚は約 1.0 µm であり,その抵抗は著 しい温度依存性を有しており、10⁻² ~10⁻⁴℃ の微小な温度変化を測定する高感度温度セ ンサとして活用できる.ここでは、TMT の作製方法と、その応用として酵素反応熱 を利用して生体物質を感知する酵素センサ システムに関して報告する.

2. TMT の作製方法と基礎特性

TMT は金属薄膜を酸化物に転換させた 複合膜である.本研究では,複数の金属を 順次蒸着し,次いで,これらの膜を高温で アニーリング処理を施し酸化させ,半導体 に転換させる方法を検討した.金属酸化物 薄膜を作製するには,他に金属酸化物粉末 を融点以上の高温で加熱して蒸着させるフ ラッシュ法等があるが,材料の組成と薄膜 の組成にばらつきが生じる等の欠点があっ た.本方法では,これらのばらつきは比較 的良好に押さえることができる.

図1はTMTの作製工程を示す.薄膜の 作製は,抵抗加熱法による真空蒸着で行っ た.基板を真空蒸着装置の上方に設置す る.基板は耐熱性があり,かつ,試料に対 する電気的影響が少ないアルミナ基板を用 いた.まず,Ni,Mn,Feを所望の金属成 分比(Ni:Mn:Fe=2:3:1)に応じた膜 厚となるように,通電電流や蒸着時間を制 御して基板上に順次蒸着する.蒸着時の真 空度は3.0×10⁻⁵ Torr とした.次いで,電気 炉にて,空気雰囲気中でアニーリング処理 を行い,両端に電極を蒸着しTMT が作製 される.

図2は、アニーリング工程の温度プロフ アイルを示す、アニーリング工程は温度上 昇、定温保持および冷却のプロセスで行わ



図1 TMT の作製工程 Fig. 1 Preparation process of TMT.



れる.ここで,温度上昇を経て,最高温度 の定温保持の工程で Ni, Mn, Fe の金属膜 は固溶体となり,炉内の酸素と結合して金 属酸化物に転換する.冷却工程では薄膜に クラックが生じる危険性があるため,冷却 時間を約8時間とした.

図 3 は定温保持温度および時間をそれぞ れ 1000℃, 30 分とした TMT の金属成分の 定量分析結果を示す. 同図より, Ni, Mn, Fe の金属重量成分比は 33:50:17 であり, ほぼ蒸着時の金属成分比を保っている.





図 5 TMT の表面 Fig. 5 Magnified surface of TMT.

図 4 は TMT の外形を示す.アルミナ基 板(縦:6 mm, 横:10 mm, 厚さ0.8 mm) 上に 1.0 μm の金属酸化膜が形成されてお り,その膜上に電極(Ag)が設置されてい る.

図 5 は, TMT の表面拡大写真である. 粒子が緻密に結合されていることがわか る.また,冷却に時間をかけているためク



図 6 アニーリング時間が異なる TMT の 抵抗の温度特性 Fig. 6 Temperature dependence on the resistance of TMT with annealing time.



ラックは生じていない.

図6および7は、それぞれアニリーング 工程における定温保持期間の時間および温 度を変えた場合の TMT の抵抗の温度依存 性を示す.両図より、いずれの条件におい ても、TMT の抵抗は温度の上昇に伴い減 少する傾向を示し、著しい温度依存性を有 しており、サーミスタの特性に類似した半 導体特性を示すことが分かる.アニリーン グ時間を 15 分~90 分と変化させた場合、 30 分を境に長くなるに伴い、全体的に抵 抗値が高くなる傾向を示した.また,TMT の抵抗はアニリーング温度が 1000℃まで はほとんど同じ特性を示すが,それ以上に おいてはアニーリング温度が高いほど抵抗 が大きくなる傾向が明確に現れている.

TMT の抵抗 R はサーミスタ同様, 次式 で表せる.

 $R = R_0 e^{B/T}$ (1) ただし、 $R_0 \ge B$ は定数、Tは温度である. 上式から、R は温度依存性を有し、温度が 上昇すると低下することが伺われる、また、温度係数 α は下式で示される.

$$\alpha = \frac{1}{R} \frac{dR}{dT} \qquad \dots \qquad (2)$$

式(2)を用いて TMT の温度係数αを計 算すると約-4.9%となり,一般的に使用さ れているサーミスタと同等かそれ以上であ る. また, TMT は, ビード型サーミスタ 等に比べ, 熱容量が小さく, 温度依存性が 極めて大きいという特徴を有する.

3. TMT の酵素センサへの応用

酵素センサは 10⁻² ~10⁻⁴℃という微少な 温度変化をとらえ,試料中の特定酵素成分 を計測するバイオセンサである.酵素反応 は定常,定温,定圧下で行われ,その大部 分は発熱変化を伴う.この熱変化を簡易な 測定装置で検出できれば,容易に反応系物 質を定量できる.多成分系であっても,酵 素を受容体として用いることで,特定の分 子やイオンを選択的に識別できる.

反応系における熱変化量をQとすれば, Qは次式で与えられる⁸⁾.

 $Q = C_s \times \Delta T = -n_p \times \Delta H$ ………… (3) ただし, C_s は熱容量, ΔT は温度変化, n_p



図 8 TMT を用いた酵素センサシステム Fig. 8 Enzyme sensor system utilizing TMT.

はモル数, ΔH はエンタルピー変化量であ る.したがって,反応系の温度変化ΔT を 測定すれば,特定成分の濃度を求めること ができることから,TMT の抵抗の感温特 性と酵素の触媒作用を利用した酵素センサ も構成を検討した.

図8はTMTを用いた酵素センサシステ ムの構成を示す. 被試験物(試験溶液)を 入れた試験管中に TMT を浸し, 酵素また は精製水を注入器により試験管内に注入す ると試験管内で酵素反応が起こり反応熱が 発生する. この酵素反応熱による TMT の 抵抗値変化をブリッジ回路により電気信号 変化へと変換して出力する. TMT はノイ ズ等を考慮し、抵抗の線形性及び安定性の 面で優れていた定温保持温度および時間を それぞれ 1000℃, 30 分としたものを用い た. また, TMT 表面の保護のため, エポ キシ系樹脂でコーティングを行った。ま た、反応熱が微少であることから、外部か らの熱の影響を抑えるため、試験管は水の 入ったビーカーに入れ、全体を恒温槽内に 設置し温度を一定(35℃)に保持した.

図9は、カタラーゼ酵素溶液(容積:10 ml, 濃度:10 mg/ml)中に試験溶液である 過酸化水素水(容積:0.1 ml, 濃度:0~5%) を滴下した場合の本システムの応答特性を 示す.出力 V_o は、試験溶液濃度が 0%(精 製水)の場合は応答をほとんど示さない が、それ以外の濃度においては過酸化水素 を滴下してから約 150 秒後から立ち上が り、300~350 秒後にピーク値を示す.ま た、ピーク値の大きさは試験溶液濃度に比 例し、濃度が高くなるほど大きな値を示し た.

図 10 は、ウレアーゼ酵素溶液(容積:10 ml, 濃度:10 mg/ml) 中へ尿素溶液(容積: 0.1 ml, 濃度:0~50 mg/ml)を滴ドした場 合の応答を示すが、過酸化水素水とカタラ ーゼ酵素との試験結果と同様に、試験溶液 濃度が 0 mg/ml(精製水)の時には出力 V_0 に大きな変化が見られなかったのに対し、 濃度が増すにつれて、 V_0 が大きくなる傾向 が見られた.

図 11 は、ウレアーゼ酵素溶液(容積:10 ml, 濃度:10 mg/ml)中へ尿素溶液(容積: 0.1 ml, 濃度:30,50 mg/ml)単独,および尿素溶液(容積:0.1 ml,濃度:30 mg/ml) と過酸化水素水(容積:0.1 ml,濃度:30 mg/ml) と過酸化水素水(容積:0.1 ml,濃度:3%) との混合溶液を滴下した場合の応答を示 す.同図より、酵素溶液中へ混合溶液を滴 下した場合の出力 V_0 は、そのピーク値や 過渡応答の波形等が同濃度の尿素溶液に滴 下した場合の応答と近い応答特性を示し、 混合溶液に対しても物質の特定と濃度計測 が可能であることが分かる.

以上から,TMT は酵素反応熱を検出し ており,かつその濃度に応じた抵抗値変化



図 9 カタラーゼー過酸化水素水に対する 酵素センサシステムの過渡応答特性 Fig. 9 Transient response of enzyme sensor system to catalase - hydrogen peroxide.





Fig. 10 Transient response of enzyme sensor system to urease - urea.





を示すことが分かった.

4. 結言

以上,真空蒸着法による感温金属酸化物 薄膜 TMT の作製と酵素センサへの応用に ついて報告した.

TMT は, Ni, Mn, Fe の各粉末を順次ア ルミナ基板に蒸着した後、アニーリング処 理を施すことにより作製される. TMT の 抵抗は、顕著な温度依存性を有し、温度が 上昇すると減少する傾向を示し、サーミス タと同等の特性を有する。本研究で作製し た薄膜は再現性が良く、蒸着時間等を調整 することにより所望の膜厚に成形すること ができる.また、TMT の応用として熱型 の酵素センサシステムを構成し、酵素反応 を測定したところ,発熱反応による TMT の抵抗変化に伴う出力電圧が得られ、その ピーク値は試験溶液の濃度に依存し、濃度 が多い程値が大きくなることが分かった. また混合溶液に対しても物質の特定と濃度 計測が可能であることが分かった. 従来の 熱型酵素センサとしてビードサーミスタを 用いたものが知られているが、TMT は薄 膜であるため, ビード型に比べて熱容量が 小さく、より分解能を挙げられることが期 待できる.

参考文献

- 1) 二木久夫:「感温度半導体」, 産報出版(昭63)
- 2)加藤禎彦:「セラミック半導体」,技研,111~123 (昭和 63)
- 3) 菊池隆之, 簗瀬 仁, 横田博久, 千葉茂樹, 長田 洋, 関 享士郎, 菊地新喜:「金属複合 膜の作製とバイオセンサへの応用」電気関係

学会東北支部連大 2G7 (平成 8-8)

- 4)安宋善史,長田 洋,石井 修,島津誠一, 千葉茂樹,関 享士郎,吉田豊彦:「スパッタ 法による感温磁性薄膜の作製と特性評価」,電 気学会マグネティックス研究会(平成 8-10)
- 5) G. Decristoforo, B. Danielsson:"Flow Injection Analysis with Enzyme Thermistor Detector for Automated Determination of b-Lactams, Anal.Chem. 56, 263-268 (1984)
- 6) K. Mosbach, B. Danielsson:"Thermal Bioanalyzers in Flow Streams Enzyme Thermistor Devices, Anl. Chem. 53, 1, 83A-86A(1981)
- 7) B. Danielsson: "The Enzyme Thermistor", Applied Biochemistry and Biotechnology, 7, 127-134 (1982)
- 8) K.Mosbach, 佐藤生男:「酵素サーミスタ」, 蛋 白質核酸酵素, 30, 4, 285-298 (1985)